DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 1999 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available PHOSPHOR PLATE FOR RADIATION IMAGE READING

PUB. NO.: PUBLISHED:

02-129600 [JP 2129600 A] May 17, 1990 (19900517) ETSUNO NAGAAKI

INVENTOR(s):

HIRANO HIROSHI IWASE NOBUHIRO TAKEDA SHIRO NAMIKI FUMIHIRO

SUGIYAMA YUICHI APPLICANT(s): FUJITSU LTD [000522] (A Japanese Company or Corporation). JP

(Japan)

APPL. NO.: FILED:

63-282804 [JP 88282804] November 09, 1988 (19881109) [5] G21K-004/00

INTL CLASS:

JAPIO CLASS: 23.1 (ATOMIC POWER -- General)
JAPIO KEYWORD: ROO2 (LASERS); R115 (X-RAY APPLICATIONS); R124 (CHEMISTRY --

Epoxy Resins)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1086, Vol. 14, No. 353, Pg. 110, July 31, 1990 (19900731)

ABSTRACT

PURPOSE: To evade deterioration in resolution while increasing sensitivity by forming a support plate which has holes in its thickness direction by using a material which transmit neither light for reading nor light to be excited and charging a phosphor where radiation is stored in the holes.

CONSTITUTION: As phosphor 1, material obtained by mixing a binder in the powdery or resin state of phosphor crystal is used. The support plate 2 is formed of a material, such as a stainless steel, which does not transmit 1st light for reading and 2nd light excited with the light. Many small holes 3 are formed in the support plate 2 in a thickness direction and the phosphor 1 is charged therein. The holes 3 are more than picture elements required for an image and arranged uniformly or at random. The cross section of the holes 3 is, for example, a circle and the size of the holes 3 is smaller than that of one picture element. The depth of the holes 3 is about 1/4-20 times the diameter. The holes 3 may be through holes, but the flank is slanted and the flat bottom surface is increased in reflection factor to obtain the effect that 2nd light is projected from the holes 3 without spreading.

Japan Unexamined Parent Belln.#2(1990)-12960C

9日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-129600

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成 2年(1990) 5月17日

G 21 K 4/00

N 8805-2G

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

匈発明の名称 放射線画像読取用螢光体板

②特 願 昭63-282804

②出 願 昭63(1988)11月9日

⑩発 明 者 越 野 長 明 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑫発 明 者 平 野 弘 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑩発 明 者 岩 瀬 信 博 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑩発 明 者 武 田 志 郎 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

①出 願 人 富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

四代 理 人 弁理士 井桁 貞一

最終頁に続く

取於貝に称く

明細書

発明の名称
 放射線画像読取用螢光体板

2. 特許請求の範囲

(1) 厚さ方向に複数の穴を持つ支持板と、該穴に充塡された放射線像を蓄積する螢光体とを有し、

該支持板は該螢光体の読出用の第1の光及びそれによって励起される第2の光を透過しない材料で形成され、該穴は画像として必要な画素の数以上あり、均一に或いはランダムに配置されていることを特徴とする放射線画像読取用螢光体板。

(2) 請求項1の支持板は複数の貫通孔を開けた薄板を複数枚該貫通孔を合わせて厚さ方向に重ねた部分を含むことを特徴とする放射線画像読取用螢光体板。

3. 発明の詳細な説明

(概要)

蓄積性螢光体板(イメージングプレート)に関

し,

蟹光体層を厚くして感度を上げても、解像度の 劣化しない蓄積性の螢光体板を得ることにより、 X線等の放射線画像読取装置の性能向上を目的と し、

厚さ方向に複数の穴を持つ支持板と、該穴に充 塡された放射線像を蓄積する螢光体とを有し、

該支持板は該螢光体の読出用の第1の光及びそれによって励起される第2の光を透過しない材料で形成され、該穴は画像として必要な画素の数以上あり、均一に或いはランダムに配置されているように構成する。更に、前記の支持板は複数の貫通孔を開けた薄板を複数枚該貫通孔を合わせて厚さ方向に重ねた部分を含むように構成する。

〔産業上の利用分野〕

本発明は放射線画像読取用の蓄積性螢光体板に関するものである。

蓄積性螢光体板は、 X 線等の放射線の 2 次元画像を一旦蓄積し、次にレーザ光等の電磁幅射線を

照射することによって、 蓄積された放射線のエネルギに従って第2の電磁幅射線を放出させ、それを電気信号に変換することで2次元の放射線画像を読み取る装置!!に使用される。

1) 例えば、

山田、他、"画期的な X 線写真システム"; サイエンス、(1984-1) p82~91.

このときの、第1の光は可視光に限らず赤外線

の量を減少できると同時に、読出に必要な第1の 光の照射量も低減できるため、より高速の走査が 可能となり、読取にかかる処理時間も減少できる ようになる。

螢光体の放射線に対する感度を増大させる一つの方法として、放射線の吸収を増加させる方法がある。放射線をより多く吸収させるには、螢光体材料に原子量の大きな元素を多く使えばよい。或いは見掛け上の感度を上げるには、放射線を受けて2次元画像を蓄積する螢光体層の厚さを増やせばよい。

〔発明が解決しようとする課題〕

蟹光体の放射線に対する感度を増大させるために蟹光体層の厚さを大きくすると、一般には解像度を犠牲にすることになる。

第7図は従来例の問題点を説明する図で、読出 用光ピームが螢光体板に入射したときのピームの 広がりを示す断面図である。

図において、光ピームが厚さ方向に侵入するに

から紫外線の範囲の広い波長の光が使われる。但 しその選択は使用される螢光体材料によって異なる。

第2の光も赤外線から紫外線まで種々の波長を 持っている。その違いも使用される螢光体材料に 依存する。

蓄積性螢光体には、可視や近赤外の光を照射するとそれより被長の短い可視から紫外の光が放出されるものと、熱作用の大きい波長の長い赤外線を照射するとやはり波長の短い可視から紫外の光が放出されるものとがある。

前者は輝尽性螢光体、後者は熱螢光体と呼ばれている。

〔従来の技術〕

蓄積性螢光体を使う放射線画像読取システムを さらに改善するためには、螢光体の感度を向上し て従来より弱い放射線に対しても大きな発光強度 を得ることが必要である。

螢光体が高感度であれば, 露光に必要な放射線

従って、光ピームは螢光体の結晶粒の表面や結晶 粒界によって散乱されるため次第に広がる。

螢光体板が既に放射線の照射を受けて2次元の 放射線像を蓄積している場合は、広がった光ビー ムによって照射を受けた螢光体材料がすべて第2 の光を発する。

画像の解像度は細い光ピームの断面の大きさに 依存する。即ち、螢光体板の小領域に読出用光ピームを照射して、そこから発する第2の光を速や かに検出し、次に読出用光ピームを横に移動して 螢光体板の次の小領域からの第2の光を検出する。 ここで読出像の解像度を大きくするためには、で きるだけ小面積の領域からの第2の光を独立して 分離できるようにする必要がある。

本発明は螢光体層を従来より厚くして感度を上 げても、解像度の劣化しない蓄積性螢光体板を得 ることを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

上記課題の解決は、厚さ方向に複数の穴を持つ

支持版と、該穴に充塡された放射線像を蓄積する 観光体とを有し、該支持板は該観光体の読出用の 第1の光及びそれによって励起される第2の光を 透過しない材料で形成され、該穴は画像として必 要な画素の数以上あり、均一に或いはランタムに 配置されている放射線画像読取用観光体板、更に、 前記の支持板は複数の貫通孔を開けた薄板を複数 枚該貫通孔を合わせて厚さ方向に重ねた部分を含 むことを特徴とする放射線画像読取用螢光体板に より達成される。

第1図は本発明の原理図で、螢光体板の断面図 である。

図は、支持板2に開けられた穴3に螢光体1を充塡した状態が示される。

次に、各構成要素について説明する。

① 螢光体1:

螢光体 1 は螢光体結晶の粉末の状態。或いは樹脂のようなバイングを混入した形でもよい。又、一旦バインダとともに充填された後。バインダを除去したものでもよい。

穴3の断面形状は円でも矩形でも不定形でもよいが、円または多角形である方がよい。一般に穴の大きさ(径又は辺)は1 画素の大きさ(径又は辺)以下であることが望ましい。穴の深さは直径またはこれに相当する寸法の1/4 以上で20倍以内が適当である。

穴の断面は厚さ方向に対しては略一様であるか、 又は側面が傾斜しており底面が小さく入り口で大 きくてもよい。

又、穴は貫通する必要は必ずしもない。特に、側面が傾斜して平坦な底面があり、しかも側面底面ともに第1及び第2の光に対して反射率を高くしてある場合は、第2の光が穴から出射するときは、その方向が広がらないという大きな効果がある。第2図は穴が貫通しない場合の例を示した断面図である。

第3図は第1図及び第2図を上方より見た螢光体板の斜視図である。

② 支持板2:

支持板2は読出用第1の光及びそれによって励起される第2の光を透過しない材料で形成する。 従ってそれ以外の波長の光に対しては透明であってもよい。

支持板 2 には多数の小さい穴 3 が厚さ方向に形成され、この中に螢光体 1 が充塡されている。

穴(セル)の数と配置は画像として必要な画素の数以上で、均一にあるいはランダムに配置さている。

支持板2の材料はステンレス鋼等の金属、アルミナ等のセラミックス、炭素材料、或いは第1及び第2の光を吸収する顔料あるいは染料を分散させたプラスチック、或いはガラスやプラスチックのように透明な材料であっても表面(螢光体面の側面、底面)に反射性または吸収性の物質(顔料や染料を含むプラスチック層等)を被覆したあってもよい。或いは、それらの複合物であってもよい。

③ 六3:

(作用)

本発明は蓄積性螢光体の見掛け上の感度を上げ、 より少ない放射線露光量で、より速い読出用光ビ ームの走査を可能にしたものである。

本発明では従来の蓄積性螢光体板と同様に使用できる。

多数の穴に充填された螢光体は、 2 次元の放射 線像を蓄積する。これを読出すために第1の光ビ ームを照射すると、螢光体の充填された穴に侵入 した第1の光ビームは螢光体を支持する不透明な 材料の中には侵入しない。或いは、反射層がある 場合はここで反射されるため、たとえ螢光体によって散乱を受けたとしても広がることはない。

ここで、第1の光ピームの螢光体板表面での斯面の大きさは、必要とする1画素の大きさより小さいか、又は1画素分に対応する面積以上の領域に配置されたセルを覆う面積より小さくする。

又, 第1の光ピームにより励起されて発光する 第2の光も観光体を支持する板の材料の中には侵 入できない。 従って、このような場合の2次元画像の解像度は螢光体を充塡している穴の面積に依存し、厚さ方向の大きさ、即ち螢光体層の厚さには依存しな、い。

従って、穴の面積を小さく、螢光体層の厚さを 大きくすれば、従来は不可能とされていた、螢光 体板の解像度を大きく保ったままでの高感度化が 実現できる。

更に、本発明は前記の穴の形成に、微細加工の可能なリソグラフィとエッチング技術を利用して 薄板に貫通孔を形成したものを積層して支持板と することにより画素の高密度化を可能としたもの である。

〔実施例〕

第4図は本発明の一実施例を説明する螢光体の 支持板の斜視図である。

厚さ50μm、352 mm×352 mmの大きさのステンレス鋼の薄板(201~210)に、直径50μmの穴3を 縦横70μmビッチで中央部全面に形成した。

このようにして作製された螢光体板を医用の胸部 X 線撮影用診断装置のカセッテ挿入部に入れ、 X 線露光し、次に暗所に保ったままで半導体レーサビームを順次螢光体面を走査させ、発光する光を光電子増倍管で受けて光電変換をした。

ここで、半導体レーザの波長は 780 nm, 走査 速度は 50 m/sec である。

光電変換された信号を 256段階の諧調のある高 解像度プラウン管で表示したところ、鮮明な胸部 撮影像を得ることができた。

この際のX線露光量は、通常の銀塩フィルムでの撮影の場合の1/10以下で十分であった。

第6図は上記の支持板2を使用した螢光体板の 他の実施例を説明する断面図である。

この例は、螢光体1を各穴に充填した支持板2 の片面のみをポリエチレンテレフタレートのシート5に接着したものである。

又、別の実施例として、穴を形成した薄板を重ねる際、片側を穴を形成しない薄板とした(第2図に相当)。この場合は螢光体を穴に充塡する際

存板の縁の部分は枠としての強度を保つため穴 は作られていない。

穴3の形成は通常のリソグラフィとエッチング 技術により行った。

この薄板 (201~210) を10枚用意し、穴の位置を 併せて重ねて固定して支持板 2 とした。

第5図は上記の支持板2を使用した螢光体板の 一実施例を説明する断面図である。

図において、支持板2をガラス板6上に載せ、 別途用意した螢光体と有機パインダの混合溶液を 支持板2の上に滴下し、テフロン棒でその表面を ならして余分な螢光体を除去し、すべての穴に螢 光体1を充填した。

螢光体 1 はユウロビウムで活性化した塩化臭化バリウム (BaC1Br: Eu), バインダにはエポキシ樹脂を使った。

更に、 螢光体を充塡した支持板 2 をエポキシ接着剤でガラス板 6 の上に接着し、反対側の表面を保護膜 4 としてポリエチレンテレフタレートのフィルムで同様の接着剤で接着した。

に漏れることがないので、保護膜を付けないでそのまま放射線画像読み取り実験を行ったところ、 第6図の螢光体板と同様に良好な X 線画像を読み 出すことができた。

以上の実施例においては、支持板の形成は薄板を用いて、リソグラフィによる穴形成と薄板の重ね合わせにより行ったが、所望の厚さの板にドリル、或いは放電加工、超音波加工等を用いて行ってもよい。

穴に充塡する螢光体は輝尽性螢光体、又は熱螢 光体であればいずれでも本発明は適用できる。

例えば,実施例の他に,

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 等の【A 族アルカリ金属と,

Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra等のアルカリ土類金属と.

F, Cl, Br, I等のハロゲン元素又は 0, S, Se 等のカルコゲン元素

との化合物を母体とし、これに

La, Ce, Pr. Nd. Pm. Sm. Eu, Gd. Tb. Dy. Ho.

Er, Tu, Yb, Lu のランタナイド元素, 又は Ho 等の遷移金属元素, Tl, Bi 等の発光中心を 入れた螢光体等が使える。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、 螢光体層の厚さを従来より厚くして感度を上げても、解像 度の劣化しない蓄積性螢光体板を得ることができる。

従ってX線等の放射線の2次元画像を、放射線の小さな露光量で、鮮明な画像が得られるので、放射線画像読取装置の性能向上に寄与できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の原理図で、螢光体板の断面図、 第2図は支持板の穴が貫通しない場合の例を示 した断面図、

第3図は第1図及び第2図を上方より見た螢光 体板の斜視図。

第4図は本発明の一実施例を説明する螢光体の

支持板の斜視図.

第5図は上記の支持仮を使用した螢光体板の一 実施例を説明する断面図。

第6図は上記の支持板を使用した螢光体板の他の実施例を説明する断面図。

第7図は従来例の問題点を説明する図で、読出 用光ピームが螢光体板に入射したときのピームの 広がりを示す断面図である。

図において,

1は螢光体.

2 は支持板,

201~210 は支持板2を構成する

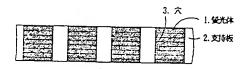
ステンレス網の薄板.

3 は穴.

4 は保護膜で、ポリエチレンテレフタレート のフィルム,

5 はポリエチレンテレフタレートのシート, 6 はがラス板 である。

代理人 弁理士 井桁真一层标理



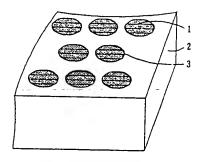
本発明の原理図で貸光体板の断面図

第 1 図



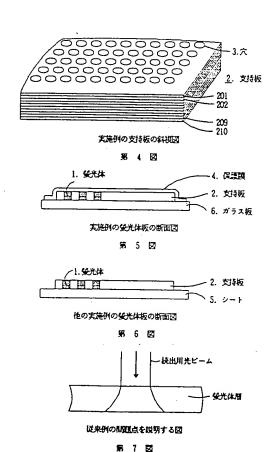
支持板の穴が貫通しない場合の断面図

第 2 図



第1. 2回の優先体板の斜板図

第 3 図



第1頁の続き

②発明者並木文博神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地富士通株式会社内 内 一种奈川県川崎市中原区上小田中1015番地富士通株式会社

内